



S20

ION SPUTTER COATER

高真空双靶离子溅射仪

The S20 is a high-vacuum dual-target ion sputter coater based on magnetron sputtering technology. It integrates a turbo molecular pump and an oil-free diaphragm pump to provide an ultra-clean high-vacuum environment ($<5 \times 10^{-2}$ Pa). Featuring a coordinated design of tilted dual-target and rotary sample stage, it deposits uniform and stable conductive coatings on sample surfaces. The system is widely suitable for (ultra-)high-resolution FE-SEM sample preparation, particularly for 3D powder samples and delicate specimens. Available sputtering materials include Au, Pt, Pd, Ir as well as Pt-Au and Pt-Pd layered alloys, etc.

S20是一款基于磁控溅射原理的高真空双靶离子溅射仪，采用内置涡轮分子泵与无油隔膜泵联用，可提供洁净的高真空环境（ $<5 \times 10^{-2}$ Pa）。结合倾斜双靶与旋转样品台的协同设计，可在样品表面形成均匀、稳定的导电镀层，广泛适用于（超）高分辨场发射电镜样品、特别是3D粉末类和易损伤类样品的镀层制备。可溅射金属：Au、Pt、Pd、Ir和任意组份的 Pt-Au、Pt-Pd 叠层合金等。

触摸屏控制，即插即用。



双靶磁控溅射
特色Pt-Au叠层配方

无油高真空泵组
清洁紧凑轻量化

倾斜靶+旋转台设计
对3D类样品友好

SuPro Instruments LTD

速普仪器

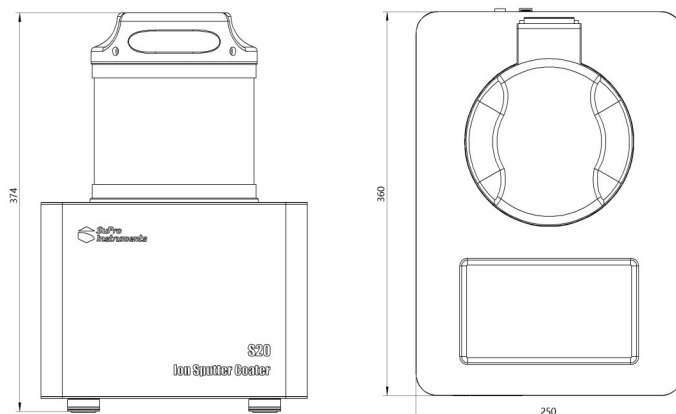
Nanshan ,
Shenzhen, China

www.suproinst.com

Tel: 86-755-26642901

Fax: 86-755-26419205

技术规格	参数
真空泵组	涡轮分子泵+无油隔膜泵
抽速	≥隔膜泵 0.7 m ³ /h + 分子泵30.5 m ³ /h
极限真空	< 5*10 ⁻² Pa
工作气压	0.5-2Pa
气体控制	MFC气体质量流量控制器 (50 SCCM N ₂)
泵组启动时间	< 3-5Min
溅射计时	0-300S
真空规	高真空复合真空计 (测量范围: 大气压-10 ⁻³ Pa)
腔室尺寸	~Ø150 *120mm
旋转样品台	直径: 80mm; 转速: 60RPM, 靶基距: 55-70mm连续可调
溅射靶材	靶材尺寸 Ø30 * 0.2-1mm/2片, 支持单靶溅射和双靶顺序溅射两种模式
溅射电源	恒功率DC溅射电源 Max. 30W, Max. 100mA, 0-800V DC
进气口	Ø6mm气管
操作方式	触摸屏控制, 控制系统提供互锁保护功能
重量	~15kg
尺寸	~250mm长 *360mm深 *374mm高
电源	100-240V AC, 180W Max.
质保	一年
备注	以上所列技术规格与参数更新恕不另行通知, 如有疑问请联系我们



深圳市速普仪器有限公司

地址: 深圳市南山区桂庙路22号向南瑞峰B2009

电话: 0755-26642901 传真: 0755-26419205

邮件: sales@suproinst.com

www.suproinst.com

速普仪器(太仓)有限公司

地址: 苏州市太仓健雄路大学科技园11号楼1003

邮件: zkchang@suproinst.com

深圳市速普仪器有限公司(北京办)

地址: 北京市房山区怡和北路5号院熙悦汇4号楼307室